

无栏目

日光温室黄瓜不同叶位叶片光合作用研究

艾希珍,张振贤,何启伟,孙小镭,邢禹贤

山东农业大学园艺学院

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 日光温室黄瓜叶片的Pn和CE以中、上位较高,尤其是第4位叶最高,顶部叶和中下位叶次之,下位叶最低,光合作用饱和光强也以中位叶最高,但光补偿点多随叶位的下降而降低,基部弱光和CE降低是导致下位叶Pn降低的主要原因。在黄瓜生长期,各叶位叶片的Pn随PFD的升高而增大。不同叶位叶片Pn的日变化规律基本相同,均呈单峰曲线型,高峰出现在12时左右。随着种植密度的增加,植株各层次叶片的光量子通量密度逐渐降低,尤其是中下部叶片降低幅度较大。种植密度对上位叶的Pn影响不大,但对光补偿点影响较大;下位叶的Pn及其饱和光强多随种植密度的增加而降低,但不同密度处理的光补偿点差异不显著。黄瓜叶片对光强有一定的适应和调节能力,表现为光照越弱,AQY越高,对光的利用能力越强。

关键词 [黄瓜](#) [光合作用](#) [日光温室](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [艾希珍](#); [张振贤](#); [何启伟](#); [孙小镭](#); [邢禹贤](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (216KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“黄瓜”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [艾希珍](#)
 - [张振贤](#)
 - [何启伟](#)
 - [孙小镭](#)
 - [邢禹贤](#)